특허의 기본 요건 및 심사 절차

김지은*
특허청 특허심사3국 응용소재심사과
(jekim3000@korea.kr*)

특허권은 발명에 대하여 보호를 부여하는 것을 말하고, 특허법은 이러한 발명을 보호 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하는 법이다. 특허법 제2조제1호에 따르면 특허법에 의하여 보호될 수 있는 발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이라고 정의되어 있고, 이러한 발명은 완성되기만 하면 그에 대한 보호가 부여되는 것이 아니라 특허출원절차를 거쳐 심사, 특허결정 및 설정등록절차를 밟아야 비로서 독점배타적인 효력을 가지는 특허권으로서 보호를 받을 수 있게 된다. 우리 특허법에는 특허출원한 발명이 특허를 받기 위하여 만족하여야 하는 요건인 특허요건(협의의 특허요건인 특허법 제29조의 신규성, 진보성 등의 요건과, 광의의 특허요건인 특허법 제62조에서 규정하고 있는 거절이유에 해당하지 않을 것이라는 특허요건을 모두 포괄하는 것임)이 규정되어 있고, 이러한 요건이 충족되는 발명에 한하여 등록결정이 이루어진다. 본 발표에서는 상기한 신규성 및 진보성의 협의의 특허요건과, 화학 및 화공 분야 연구자에게 도움이 될 수 있는 심사 절차를 소개한다.